表面保護 FIB 加工によるタングステンの表面最近傍断面組織の 高分解能観察

核融合科学研究所 永田大介 時谷政行 室賀健夫





Fig. 2 Fig. 1(c)の白線四角で示す断面 領域を TEM 観察した画像. ここで は、プラズマ照射によってタングステ ンの表面最近傍に発生したヘリウムバ ブルを示す.電子ビーム透過能に対し て十分な薄さの薄膜試料であるため, 高分解能による観察が可能となる.

Fig. 1 (a) 試料片を TEM 観察用のメッシュに固定する.(b) メッシュを90度プラス 10度程度回転させる.(c) 薄膜加工後の試料片.(d)(c)の試料片を前面および側面,上 面(加工ビーム方向)から見た模式図.

試料断面の微細構造を透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて 観察するためには,集束イオンビーム加工観察装置(FIB)に よってバルク試料から試料片を切り出し,さらに TEM 観察 可能な薄さに薄膜化する必要がある.特に表面最近傍の組織 を観察したい場合,表面を保護しつつ,観察可能な薄さまで 薄膜化する必要がある.本研究では,Fig.1に示す試料お よびビームを傾斜させた FIB 加工を行うことにより,くさ び形に試料を成形して,その先端近傍に特に薄い観察領域を 得ることが出来た.これにより,Fig.2に示すようなタン グステン表面最近傍の断面微細構造を,高分解能で観察する ことが可能となった.

実際の加工手順を Fig. 1 に示す. Fig. 1(a)表面に保護被 覆を施したバルク試料から試料片を切り出し, TEM 観察用 のメッシュに固定する.その際,試料片を水平に,メッシュ を45度に傾けておく.(b)メッシュを90度プラス10度程度回 転させる.これにより,パルク試料の表面が加工ビーム照射 方向から隠れるため,試料の表面を残す形で薄膜化すること が出来る.(c)薄膜加工後の試料片を示す.(d)(c)の試料片 を前面および側面,上面(加工ビーム方向)から見た模式図で 示す.(c)と(d)の黒線四角で示す領域が対応する.加工削 除する部分をグレーで示した.(d)で示すように加工ビーム を左右に傾けることによって,薄膜化領域をくさび形に成形 することが出来る.下側に向けて薄くなるくさび形に成形す ることで,(c)の白線四角で示した領域を特に薄くすること が出来る.実際のTEM 観察画像を Fig. 2 に示す.

(2018年8月2日受理[doi:10.2320/materia.57.604]

Keywords: FIB(focused ion beam), TEM(transmission electron microscopy), tungsten

TEM sample preparation: FIB-SEM

FIB-SEM: Hitachi NB5000 (Ga ion 40 kV, Electron 5 kV)

TEM: JEOL JEM-2800 (200 kV)

High Resolution Microstructural Observation of Tungsten in the Vicinity of the Surface by Surface-protective FIB Processing; Daisuke Nagata, Masayuki Tokitani and Takeo Muroga